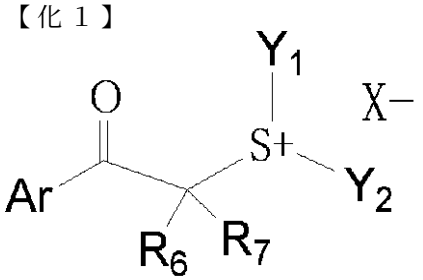
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成18年6月8日(2006.6.8)

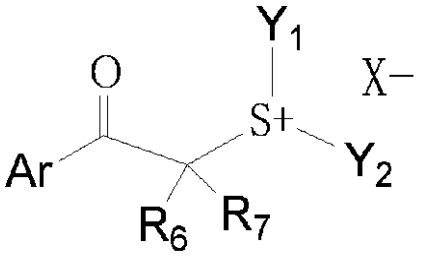
【公開番号】特開2004-139014(P2004-139014A)
【公開日】平成16年5月13日(2004.5.13)
【年通号数】公開・登録公報2004-018
【出願番号】特願2003-106524(P2003-106524)
【国際特許分類】
　Ｇ０３Ｆ　7/004　(2006.01)
【ＦＩ】
　Ｇ０３Ｆ　7/004　５０３Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成18年4月5日(2006.4.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】　（Ａ）外部からの刺激により酸又はラジカルを発生する下記一般式（Ｉ）で表される化合物を含有することを特徴とする感刺激性組成物。
【化１】



(I)

一般式（Ｉ）中、
Ａｒは、アリール基又はヘテロ原子を含む芳香族基を表す。
R_6は、水素原子、シアノ基、アルキル基又はアリール基を表す。
R_7は、１価の有機基を表す。
Y_1及びY_2は、同じでも異なっていてもよく、アルキル基、アリール基、アラルキル基又はヘテロ原子を含む芳香族基を表す。Y_1とY_2とが結合して環を形成してもよい。
ＡｒとY_1及びY_2の少なくとも一つが結合して環を形成してもよい。
ＡｒとR_6とが結合して環を形成してもよい。
R_6とR_7とが結合して環を形成してもよい。
また、Ａｒ、R_6、R_7、Y_1又はY_2のいずれかの位置で、連結基を介して結合し、一般式（Ｉ）の構造を２つ以上有していてもよい。
X^-は、非求核性アニオンを表す。
【請求項２】　（Ａ）活性光線の照射又は加熱により酸を発生する下記一般式（Ｉ）で表される化合物を含有することを特徴とする感光性又は感熱性組成物。
【化２】

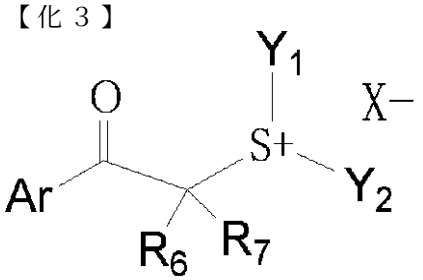


(I)

一般式（Ｉ）中、
Ａｒは、アリール基又はヘテロ原子を含む芳香族基を表す。
R_6は、水素原子、シアノ基、アルキル基又はアリール基を表す。
R_7は、１価の有機基を表す。
Y_1及びY_2は、同じでも異なっていてもよく、アルキル基、アリール基、アラルキル基又はヘテロ原子を含む芳香族基を表す。Y_1とY_2とが結合して環を形成してもよい。
ＡｒとY_1及びY_2の少なくとも一つが結合して環を形成してもよい。
ＡｒとR_6とが結合して環を形成してもよい。
R_6とR_7とが結合して環を形成してもよい。
また、Ａｒ、R_6、R_7、Y_1又はY_2のいずれかの位置で、連結基を介して結合し、一般式（Ｉ）の構造を２つ以上有していてもよい。
X^-は、非求核性アニオンを表す。

【請求項３】　下記一般式（Ｉ）で表されることを特徴とする化合物。

【化３】



(I)

一般式（Ｉ）中、
Ａｒは、アリール基又はヘテロ原子を含む芳香族基を表す。
R_6は、水素原子、シアノ基、アルキル基又はアリール基を表す。
R_7は、１価の有機基を表す。
Y_1及びY_2は、同じでも異なっていてもよく、アルキル基、アリール基、アラルキル基又はヘテロ原子を含む芳香族基を表す。Y_1とY_2とが結合して環を形成してもよい。
ＡｒとY_1及びY_2の少なくとも一つが結合して環を形成してもよい。
ＡｒとR_6とが結合して環を形成してもよい。
R_6とR_7とが結合して環を形成してもよい。
また、Ａｒ、R_6、R_7、Y_1又はY_2のいずれかの位置で、連結基を介して結合し、一般式（Ｉ）の構造を２つ以上有していてもよい。
X^-は、非求核性アニオンを表す。

【請求項４】　請求項１に記載の感刺激性組成物又は請求項２に記載の感光性又は感熱性組成物により膜を形成し、当該膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。